

2023年 第70回 応用物理学会春季学術講演会 シンポジウム ディスプレイの次のキラーアプリをねらえ！ 酸化物半導体の最前線

日時：2023年3月17日（金）13:30-17:55 E302（12号館）

オーガナイザー

東京大学 小林正治 奈良先端大 浦岡行治 キオクシア 池田圭司

13:30-14:00
招待講演



アモルファス酸化物半導体における機能開拓の最前線
東京工業大学 井手啓介

14:00-14:30
招待講演



半導体デバイス向けIGZO量産成膜技術の開発
東京エレクトロン 長坂恵一

14:30-15:00
招待講演



酸化物半導体デバイスにおける原子層堆積技術の最前線
物質・材料研究機構 生田目俊秀

15:05-15:35
招待講演



**極微細 c-axis aligned crystalline In-Ga-Zn
Oxide FETとその応用**
半導体エネルギー研究所 國武寛司

15:35-16:05
招待講演



酸化物半導体デバイスへの期待 – 強誘電体ゲートトランジスタを中心として –
北陸先端科学技術大学院大学 徳光永輔

16:05-16:35
招待講演



酸化物半導体によるAIコンピューティングの最前線
龍谷大学 木村睦

16:35-16:50
一般講演



**三次元集積デバイス応用に向けた原子層堆積法で成膜した
三元系非晶質酸化物半導体In-Ga-O**
奈良先端科学技術大学院大学 高橋崇則

16:55-17:55



パネルディスカッション
招待講演者 + キオクシア 西山彰

酸化物半導体、特にIGZOは、ディスプレイ応用として大きな成功を収めている。高移動度・低リーク電流・高信頼性・低温プロセスといった特徴をもつ酸化物半導体トランジスタは現在、超集積エレクトロニクス分野でも大きな注目を集めてきており、メモリデバイス応用、三次元集積デバイス、AIコンピューティングなどへの応用が期待されている。本シンポジウムでは次のキラーアプリとして大きな市場が見える超集積エレクトロニクス応用に向けて、物性科学、材料技術、デバイス技術、回路・システム技術の最前線を講演で俯瞰し、パネルディスカッションを通じて産学で課題と展望を議論する。



日時

2023年 3月 17日（金） 13:00~18:00

会場

上智大学 四谷キャンパス E302(12号館)会場

詳細

応物HP（右QRコード）をご覧ください。

